

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成27年3月12日 (2015.3.12)

【公開番号】特開2014-114472(P2014-114472A)

【公開日】平成26年6月26日 (2014.6.26)

【年通号数】公開・登録公報2014-033

【出願番号】特願2012-268381(P2012-268381)

【国際特許分類】

C 2 3 C 8/12 (2006.01)

C 2 5 C 1/12 (2006.01)

C 2 5 C 5/02 (2006.01)

C 0 1 G 3/02 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 8/12

C 2 5 C 1/12

C 2 5 C 5/02

C 0 1 G 3/02

【手続補正書】

【提出日】平成27年1月26日 (2015.1.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

表面に酸化皮膜を有する電解銅粉を乾式で粉砕する乾式粉砕工程と、  
この乾式粉砕工程によって得られる電解銅微粉末を酸化する酸化工程とを含み、  
前記酸化皮膜は、銅イオン含有溶液の電気分解によって得られる電解銅粉を水洗した後、酸素含有雰囲気において 70 ～ 150 の温度で乾燥することによって形成される、酸化第二銅微粉末の製造方法。

【請求項 2】

前記乾式粉砕工程は酸素含有雰囲気で行われる、請求項 1 に記載の酸化第二銅微粉末の製造方法。

【請求項 3】

前記酸化工程は、前記電解銅微粉末を 300 ～ 700 で熱することによって行われる、請求項 1 又は 2 に記載の酸化第二銅微粉末の製造方法。

【請求項 4】

請求項 1 から 3 のいずれかに記載の製造方法によって得られる酸化第二銅微粉末が溶解された硫酸銅水溶液を電解銅めっき装置の電解液として使用する、銅めっき方法。